

📦 氧化硅抛光液

氧化硅抛光液系列，采用高纯度胶态氧化硅微粒或高纯度硅粉所制成的一种高纯度低金属离子型抛光产品，可避免加工元件产生刮伤的现象，用于多种材料纳米级的高平坦化抛光，如：砷化镓、锗片、磷化铟、氮化镓、碳化硅、单晶硅、多晶硅、铌酸锂、碳酸锂、硫系红外玻璃珠中抛或精抛。



主要特征

- 根据不同需要，可生产不同粒度的产品（10-150 nm）抛光液，主要用于产品的精抛，产品稳定，抛光速率快，表面效果好，易清洗等，不会对加工件造成物理损伤，达到高平坦化加工

粒度分布和应用场景

型号	粒径 (nm)	固含量(%)	PH值	比重	密度(g/ml)
MMP-40A	40	40	9-11	1.3	1.15±0.05
MMP-60S	60	40	9-11	1.3	1.15±0.05
MMP-S80A	80	40	9-11	1.3	1.15±0.05
MMP-100A	100	40-50	10-13	1.5	1.20±0.05
MMP-1209	120	40-50	10-13	1.5	1.20±0.05
MMP-1509	150	40-50	10-13	1.5	1.20±0.05

型号	应用	描述
MMP-1209	蓝宝石精抛液	蓝宝石系列抛光液主要由各种高级化学品和高纯度胶态二氧化硅组成，特别适用于氧化锆陶瓷、蓝宝石材料的抛光（包括A\C向、单抛、双抛、蓝宝石表镜专用抛光液和异形抛光液）。具有良好的稳定性和分散性，去除率高、表面效果好以及对工件无损伤等优点。稀释比例高，使用周期长等特点。
MMP-1009	碳化硅精抛液	碳化硅抛光液主要由高纯度二氧化硅制备而成，具有高度分散性、良好抛光效率、去除量高，表面效果好，易清洗，满足客户需求。
MMP-100A	陶瓷精抛液	用于陶瓷手机后壳以及替代陶瓷材质的精抛，具有去除量高，循环寿命长，抛光性能稳定，抛光表面质量好与易清洗等特点。
MMP-120A	铝合金精抛液	该抛光液主要用于手机中框以及铝合金材质的精抛，抛光后的表面无橘皮、划伤、坑点等缺陷，液体易清洗，不易结晶；客户根据不同的工艺进行不同的调整。
MMP-60S	不锈钢精抛液	该抛光液主要用于苹果LOGO、摄像头以及其他不锈钢材质的精抛，抛光后的表面无橘皮、划伤、坑点等缺陷，客户根据不同的工艺进行不同的调整。

应用领域

硅晶片抛光； 锗片抛光； 砷化镓抛光；
磷化铟抛光； 光学晶体抛光； 蓝宝石衬底抛光；
碳化硅衬底抛光； 硒化铟抛光； 光纤连接器抛光；
光纤跳线抛光； 玻璃抛光； 石英抛光；

包装规格 5KG/25KG，桶装（可根据客户需求定制）

储存方式 存放温度为5°C~45°C，常规温度25°C，避免阳光照射

稀释比例 稀释需要去离子或蒸馏水，建议稀释比例1:1~1:5



联系中机新材，了解更多产品信息：

地址：深圳市南山区粤海街道高新区中国地质大学产学研基地C610

电话：0755-2691 0979 传真：0755-2691 1073 邮箱：info@micromaterial.com



立足中国·服务全球

Based on China and Serving the World